

## OTFC-1800 规格例



设备名称	OTFC-1800C/D
真空室	SUS304, $\phi$ 1800×1920mm(H)
工件架	$\phi$ 1600mm
工件架转速	5rpm to 50rpm(可变)
光学膜厚控制	Hom2-R-VIS350A 型光学控制 波长范围: 350nm to 1100nm 反射式/透射式
水晶式膜厚计	XTC/2+6 点式水晶传感器
蒸发源	电子枪 2 套
离子源	23cmRF 离子源
排气系统	机械泵+2 个扩散泵+Polycold (或 2 个冷凝泵)
<b>性能</b>	
达到压力	$9.0 \times 10^{-5}$ Pa 以下
排气时间	30 分 (大气压 $\sim 1.3 \times 10^{-3}$ Pa)
基板温度	最高: 350°C
<b>工作条件</b>	
设备尺寸	约 6000mm(W)×7500mm(D)×4000mm(H)
电源	3 相,200v,50/60Hz, 约 125KVA
水流量	180 升/分以上
空气压力	0.5MPa 以上
重量	约 13000kg